

エネルギー工学研究室

SDGs達成に向けた取り組み



































キーワード・研究テーマ Keywords・Research Themes

- ■プラズマ
- ■ワイヤレス給電 Wireless power transfer
- ■薄膜
- ■太陽電池

プラズマの生成や計測および材料プロセスへの応用、 磁界共鳴やマイクロ波を用いたワイヤレス給電

Study on physics and application of industrial plasma and wireless power transfer



職位 Position 大学院

教授·大学院教授

Professor • Professor at Graduate School 電子情報工学コース

Graduate School Electronics and Computer Science Course

博士(工学) 学 位 Degree

Doctor of Engineering

担当講義科目 電気機器、発変電工学 など Charge of Subjects

Electric Machinery, Electric Power Generation and

e-mail muta@fuk.kindai.ac.jp





MUTA Hiroshi

研究概要 Research Outline

プラズマのモデリングや新たなプラズマの計測法の開発、プラズマ CVDによる成膜の高速化、磁界共鳴やマイクロ波を用いたワイヤレス 給電システムの最適化などを研究しています。

Main themes are modeling and measurement of industrial plasmas, high speed deposition of thin films using plasma CVD, and optimization of wireless power transfer system.

進行中の研究内容 Research Contents in Progress

プラズマCVD法を用いたダイヤモンドライクカーボン(DLC)膜作成 において、ガス供給に超音速噴流を用いることで、従来の数百倍 の成膜速度を得ることに成功しています。現在は膜の一様性に取 り組んでいます。

In fabricating the diamond-like-carbon (DLC) thin films using plasma CVD, we have succeeded in getting the deposition rate higher by two orders of magnitude than that of conventional

2 近年大気圧でプラズマを生成する技術が急速に進み、医療や農 業への応用が拡大しています。そこで、従来困難だった大気圧プラ ズマの温度や密度の測定を低コストかつ簡便に実現できるプロー ブシステムを開発しています。

There has been remarkable progress in atmospheric plasmas for medical and agriculture fields. We have developed a new probe system which can easily measure plasma parameters at low

最近の研究実績

Recent Research Results

〈著書/Books〉

■ プラズマCVDにおける成膜条件の最適化に向けた反応機構の理解 とプロセス制御・成膜事例(分担執筆),サイエンス&テクノロジ-(2018年9月), 第9章 「超音速噴流を用いた高速・大面積均一な微 結晶シリコン製膜プロセス」牟田浩司

Understanding of reaction mechanisms and examples of the process control toward the optimization of the deposition condition in plasma CVD, Science & technology Co., Ltd. (September, 2018), Chapter 9 "High-speed and uniform preparation of the microcrystalline silicon thin film using supersonic jet", Hiroshi Muta.

〈論文/Published Papers〉

- Estimation of negative ions in VHF SiH4/H2 plasma, Tsukasa Yamane, Shinya Nakano, Sachiko Nakao, Yoshiaki Takeuchi, Ryuta Ichiki, Hiroshi Muta, Kiichiro Uchino, Yoshinobu Kawai Japanese Journal of Applied Physics Vol. 53, pp. 116101-1-4 (2014).
- 高速噴流を利用したプラズマCVD の新規高速製膜手法, ながれ34, pp. 15-20 (2015) 西田哲, 牟田浩司, 栗林志頭馬

New high-speed deposition of thin films using plasma CVD with high-speed jet, Flow (The Japan Society of Fluid Mechanics) Vol. 34, pp. 15-20 (2015).



超音速噴流を用いた DLC成膜実験



イオンビーム用 ECRプラズマ



マルチホローカソードを用いた イオンビーム